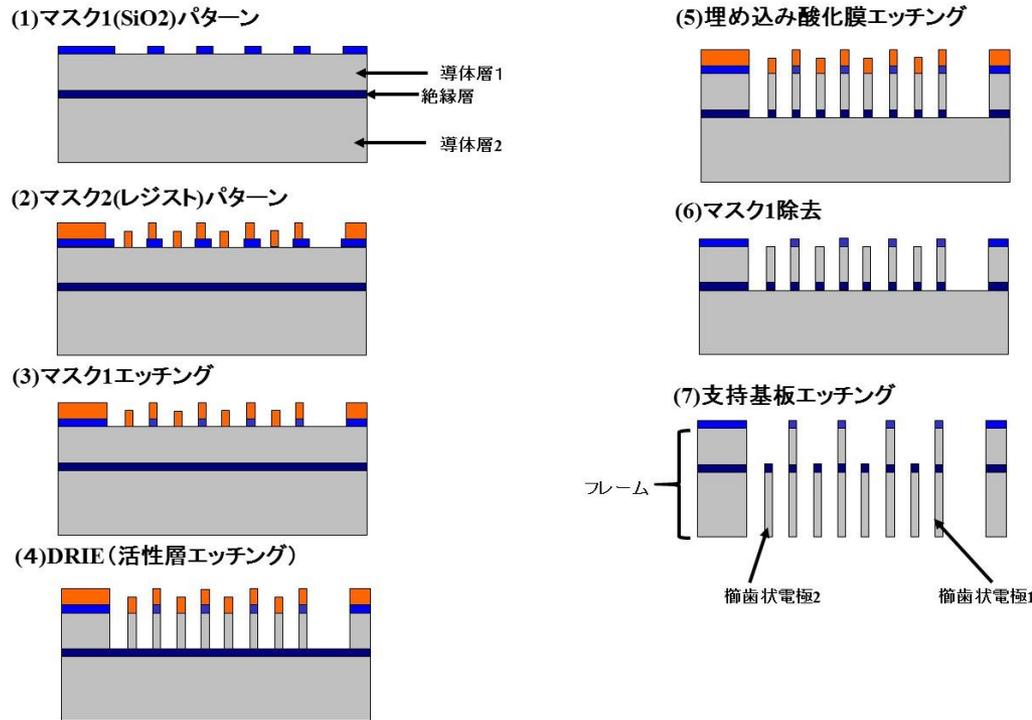


マイクロミラー素子の製造方法（1）

- 導体基板の同一面上に、2の櫛歯状電極の両方に対応するマスクパターンを形成した後、マスクパターンを形成してエッチング
- 2つの櫛歯状電極のアライメント精度を向上

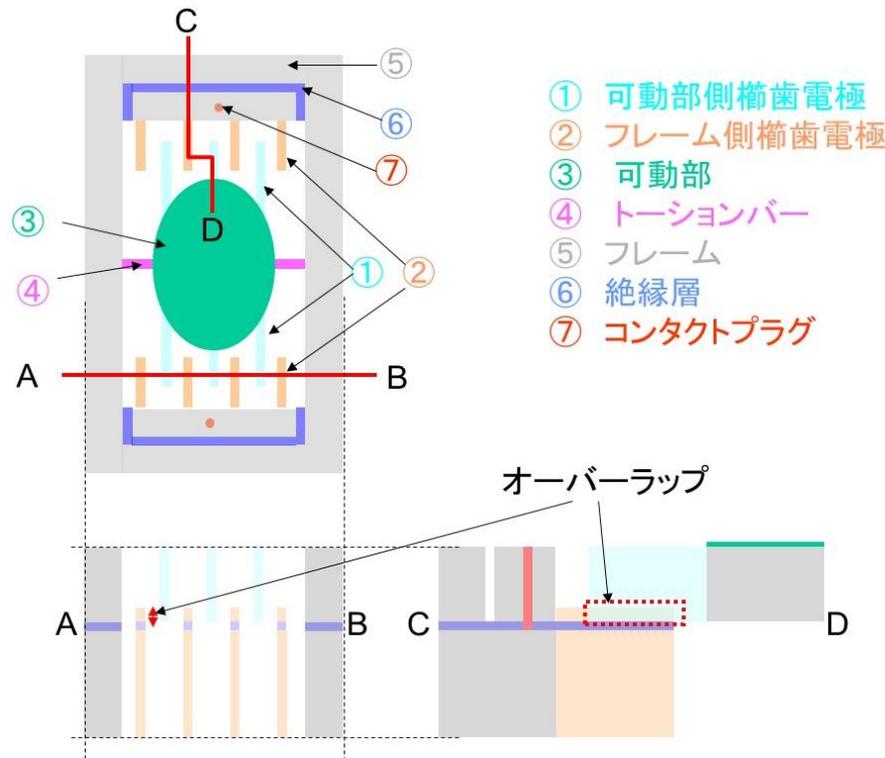


本発明によるプロセス(断面)

日本特許第4573676号, 米国特許第7439184号, 中国特許第ZL200610059745.0号,
韓国特許第10-0786739号, 台湾特許第I309069号

マイクロミラー素子の製造方法（２）

- 下部導体層/絶縁層/上部導体層の構造を持つフレーム側の櫛状電極の上部導体層に対向し、下部電極層には対向しない位置関係となることで、可動部の制御性を向上



日本特許第4573664号, 米国特許第7476950号, 米国特許第8142670号

中国特許第ZL200610009215.5号, 韓国特許第10-0809407号, 台湾特許第I297398号